

第1回「次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業」

中間評価検討会

日 時：平成28年11月1日（火）

15：00～17：00

場 所：経済産業省別館1階120共用会議室

議 事 次 第

開会

1. 研究開発評価に係る委員会等の公開について
2. 評価の方法等について
3. 次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業の概要について
4. 今後の評価の進め方について（コメント依頼）

閉会

配 布 資 料

- 資料1 中間評価検討会 委員名簿
- 資料2 研究開発評価に係る委員会等の公開について
- 資料3 経済産業省における研究開発評価について
- 資料4 評価方法（案）
- 資料5－1 ガラス固化技術の基盤整備 概要
- 資料5－2 低レベル放射性廃棄物の除染方法の検討 概要
- 資料6－1 ガラス固化技術の基盤整備 評価用資料
- 資料6－2 低レベル放射性廃棄物の除染方法の検討 評価用資料
- 資料7 技術評価結果報告書の構成（案）
- 資料8－1 評価コメント票（ガラス固化技術の基盤整備）
- 資料8－2 評価コメント票（低レベル放射性廃棄物の除染方法の検討）
- 質問票
-
- 参考資料1 経済産業省技術評価指針
- 参考資料2 経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準
- 参考資料3 次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業 事前評価報告書